

用半径—电荷比研究 SiH_mX_n 和 CH_mX_n 型分子的标准生成焓

谢 兵¹, 冯 琳², 杨 锋³, 罗明道⁴, 屈松生⁴

(1. 贵州民族学院化学系, 贵州贵阳 550025; 2. 重庆师范学院化学系, 重庆 400715;
3. 武汉科技学院环科所, 湖北武汉 430073; 4. 武汉大学化学系, 湖北武汉 430072)

摘要: 本文用原子的半径—电荷比定义原子结构参数 P_i 和分子结构参数 P . 用 P 分别研究了含氢分子 SiH_mX_n 和 CH_mX_n ($\text{X}=\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) 的标准生成焓, 二者呈良好的线性关系. 本文的定义考虑了氢对分子结构和性质的贡献.

关键词: 半径—电荷比; SiH_mX_n ; CH_mX_n ; 标准生成焓; 相关性.

中图分类号: O64 **文献标识码:** A

文章编号: 1000—2383(2001)03—0328—03

作者简介: 谢兵(1964), 男, 讲师, 1984 年毕业于西南师范大学化学系, 获学士学位, 主要从事结构化学教学和科研工作.

用结构参数研究分子的性质被证明是一种有效的方法^[1~5], 但用元素电荷—半径比作为独立的参数尚不多见. 本文试图用元素电荷—半径比构成分子结构参数 P , 并在 P 中考虑氢的贡献, 从而克服隐氢法中对氢的忽略的不足.

1 计算方法

分子中原子的性质主要决定于原子半径、氧化状态、原子在周期表中的位置和电子之间的相互作用状况. 本文中原子结构参数 P_i 定义如下:

$$P_i = \frac{m_i}{4r_i} \left(1 + \frac{n_i^*}{n_i}\right) \left(1 + \frac{Z'_i + 2}{Z}\right). \quad (1)$$

式中: m_i/r_i 为原子 i 的半径—电荷比, r_i 取单键共价半径并取相对值(令碳单价共价半径 0.077 nm 为 1), m_i 对中心原子或正价原子取为氧化数, 对配位原子或负价原子取为价电子数, Z'_i 为原子 i 的有效价电子数, 其定义见式(2), n_i^* 和 n_i 分别为原子 i 价层最高有效主量子数和主量子数, Z 为原子 i 的核外电子总数. 把 P_i 定义为式(1)的形式是为了保证碳原子的 P_i 值为 1, 2, 3, 4(对应于 $\text{CH}, \text{CH}_2, \text{CH}_3, \text{CH}_4$ 中碳的氧化状态).

Z'_i 定义为^[6]:

$$Z'_i = (I - 0.5)n_i^*. \quad (2)$$

式中: I 为鲍林电负性标度, n_i^* 同式(1).

式(1)中, $\frac{1}{2} \left(1 + \frac{n_i^*}{n_i}\right)$ 和 $\frac{1}{2} \left(1 + \frac{Z'_i + 2}{Z}\right)$ 是考虑

了原子中电子之间相互作用后对电荷—半径比的校正, 对氢原子而言, 核外只有一个电子, 不存在电子之间的相互作用, 故其 P_i 直接取 $m_i/r_i = 2.0811$.

分子的结构参数定义为:

$$P = \sum_{i=1}^n P_i. \quad (3)$$

加合遍及分子中所有的原子.

2 用 P 研究 SiH_mX_n 和 CH_mX_n 的标准生成焓

本文中, r_i, I 取自文献[7], n_i^* 取自文献[8], Z'_i 按式(2)计算.

2.1 用 P 研究 SiH_mX_n 的标准生成焓

按式(1)~(3)计算各分子的 P 并列入表 1.

对 P 和 $\Delta_f H_m^\ominus$ 进行线性回归, 得:

$$\Delta_f H_m^\ominus = 490.41 - 63.76P. \quad (4)$$

$$R = 0.9765, S = 95.9, n = 32.$$

表 1 SiH_mX_n (气态) 的分子结构参数 P 和标准生成焓 $\Delta_f H_m^\ominus$ 的实验值^[9,10]

Table 1 Molecular structural parameters P and experimental value of standard formation enthalpies $\Delta_f H_m^\ominus$ of SiH_mX_n molecules (gas state)

化合物	P	$\Delta_f H_m^\ominus/\text{kJ}$	化合物	P	$\Delta_f H_m^\ominus/\text{kJ}$
SiF	7.9112	-20.90	SiH_3F	15.4299	-376.56
SiF_2	15.8224	-589.90	SiH_2F_2	20.8349	-790.78
SiF_3	23.7337	-1000.00	SiHF_3	26.2399	-1200.81
SiF_4	31.6449	-1625.90	SiH_3Cl	11.7547	-135.56
SiCl	4.2360	154.80	SiH_2Cl_2	13.4845	-315.06
SiCl_2	8.4720	-167.80	SiHCl_3	15.2143	-499.15
SiCl_3	12.7081	-334.70	SiH_3Br	10.4629	-64.02
SiCl_4	16.9441	-662.80	SiH_2Br_2	10.9009	-180.75
SiBr	2.9442	196.70	SiHBr_3	11.3389	-303.34
SiBr_2	5.8884	-46.00	SiH_3I	9.8096	-2.09
SiBr_3	8.8327	-159.00	SiH_2I_2	9.5943	-38.07
SiBr_4	11.7769	-415.50	SiHI_3	9.3790	-74.48
SiI	2.2909	259.40	SiH	2.5062	377.40
SiI_2	4.5818	92.10	SiH_2	5.0124	271.96
SiI_3	6.8728	58.60	SiH_3	7.5186	194.97
SiI_4	9.1637	-110.50	SiH_4	10.0248	34.31

表 2 CH_mX_n (气态) 的分子结构参数 P 和标准生成焓 $\Delta_f H_m^\ominus$ 的实验值^[11]

Table 2 Molecular structural parameters P and experimental value of standard formation enthalpies $\Delta_f H_m^\ominus$ of CH_mX_n molecules (gas state)

化合物	P	$\Delta_f H_m^\ominus/\text{kJ}$	化合物	P	$\Delta_f H_m^\ominus/\text{kJ}$
CH_2F_2	23.1344	-452.9	CBrClF_2	25.3022	-471.5
CCl_2F_2	26.5940	-493.3	CH_2BrCl	14.4922	-50.2
CH_2Cl_2	15.7840	-95.4	CHBrClF	19.8972	-295.0
CHCl_2F	21.1890	-284.9	CH_2BrI	12.5471	50.2
CBr_2F_2	24.0104	-429.7	CHF_3	28.5394	-693.3
CBr_2Cl_2	16.6600	-29.3	CF_3I	28.3241	-589.9
CH_2Br_2	13.2004	-14.8	CCl_3F	22.9188	-284.9
CHBr_2F	18.6054	-223.4	CHF_2Cl	24.8642	-483.7
CHBr_2Cl	14.9302	-20.9	CF_3Cl	30.2692	-707.9
CBr_2ClF	20.3352	-231.8	CF_3Br	28.9774	-648.9
CHBr_3	13.6384	16.7	CH_3F	17.7294	-237.7
CBr_3F	19.0434	-190.0	CH_2I_2	11.8938	118.4
CBr_3Cl	15.3682	12.6	CH_2FCl	19.4592	-264.4
CHI_3	11.6785	210.9	CH_2ClI	13.8389	12.6
CF_4	33.9444	-933.0	CH_3I	12.0191	13.8
CCl_4	19.2436	-95.8	CH_2FBr	18.1674	-252.7
Cl_4	11.4632	262.9	CH_4	12.3244	-74.9
CBr_4	14.0764	79.5	CBrCl_3	17.9518	-37.2
CHBrF_2	23.5724	-463.6	CH	3.0811	594.1
CHBrCl_2	16.2220	-58.6	CH_2	6.1622	386.4
CBrCl_2F	21.6270	-269.4	CH_3	9.2433	145.7
CH_3Br	12.7624	-37.7	CHCl_3	17.5138	-102.9

其中, R 为相关系数, S 为回归方程标准差, n 为回归分子数.

2.2 用 P 研究 CH_mX_n 的标准生成焓

仍用式(1)~(3)计算出 P 并列于表 2.

对 P 和 $\Delta_f H_m^\ominus$ 进行线性回归, 得:

$$\Delta_f H_m^\ominus = 646.78 - 44.94P. \quad (5)$$

$$R = 0.9752, S = 67.9, n = 44.$$

3 讨论

(1) 本文的研究证明, 元素电荷—半径比是一个重要的原子结构参数, 由它组成的分子结构参数 P 能很好地相关 $\text{AB}_m\text{C}_n\text{D}_l\text{E}_r$ 分子的热力学性质. 考虑到原子核外电子之间的相互作用情况, 引入了 n_i^* 和 Z'_i , 研究表明, n_i^* 和 Z'_i 的引入能有效地改进电荷—半径比对原子性质的描述. 例如: 对气态 SiX_n ($\text{X}=\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}, n=1 \sim 4$), 用 4 个原子结构参数均按式(3)的方式构成分子结构参数去相关 SiX_n 体系的标准生成焓: ① $P_i = m_i/r_i$, ② $P_i = \frac{m_i}{2r_i} \left(1 + \frac{n_i^*}{n_i}\right)$, ③ $P_i = \frac{m_i}{2r_i} \left(1 + \frac{2+Z'_i}{Z}\right)$, ④ $P_i = \frac{m_i}{4r_i} \left(1 + \frac{n_i^*}{n_i}\right) \left(1 + \frac{2+Z'_i}{Z}\right)$,

相关系数分别为 0.8992, 0.9581, 0.9915, 0.9940; 标准差分别为 218.3, 142.9, 64.7, 54.4. 说明电荷—半径比虽然对分子中原子的性质有重要影响, 但构成分子的原子核外电子之间的相互作用是不能忽略的. 这就是引入 n_i^* 和 Z'_i 的目的.

(2) 对氢和第二周期元素, $n_i^* = n_i$, $Z'_i = Z_i$ 故 P_i 直接等于 m_i/r_i . 对同一主族元素, 从上到下, n_i^*/n_i 是递减的, $Z'_i + 2/Z$ 也是递减的, 表明随电子层数的增加, 原子核外电子之间的相互作用趋于复杂和增强.

(3) 作为拓扑处理, 本文没有考虑相邻原子之间的相互作用, 这对于本文处理的体系大致上是正确的, 但对于有机分子, 因一般含有链或环, 且异构体增加, 故还需对本文提出的方案作补充规定:

① 中心原子 i 的参数值 P'_i 由下式决定

$$P'_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n P_i. \quad (6)$$

加合遍及与中心原子 i 相连的所有原子 ($m-1$ 个) 和 i 原子本身.

② 与原子 i 相连的配位原子 j 的 P'_{ij} 等于 P'_{ij} 与 P_j 的算术平均,

$$P'_j = \frac{P'_i + P'_j}{2}, \quad i, j \text{ 相邻.} \quad (7)$$

③分子结构参数 P' 定义为:

$$P' = \sum_{j=1}^n P'_j. \quad (8)$$

以醛、酮、醚体系为例,用式(6)~(8)计算下列分子的 P' 值:二甲醚、甲乙醚、二乙醚、甲异丙醚、甲特丁醚、二异丙醚、异特丁醚、二特丁醚、乙醛、丙醛、2—甲基丙醛、丙酮、丁酮—2、戊酮—2、乙酮—3、庚酮—4,并用 P' 相关上述分子的标准生成焓^[12],结果为:

$$\begin{aligned} -\Delta_f H_m^\ominus &= 86.61 + 3.70P', \\ R &= 0.974 \quad l, n=16, s=13.3. \end{aligned} \quad (9)$$

说明 P' 能较好地处理有机分子并能说明异构体结构与性质的关系,如甲乙醚、丙醛、丙酮等.

参考文献:

- [1] Hansch C, Hoekman D, Gao H. Comparative QSAR: toward a deeper understanding of chemobiological interaction [J]. Chem Rev, 1996, 96: 1045.
- [2] 李林峰,游效曾.分子拓扑指数及其应用(I)[J].科学通报,1993, 83: 421.
- [3] 王化云,吕天雄,许禄,等.广义 a_N 指数及其应用 I[J].化学学报,1990, 48: 1159—1163.
- [4] Schultz H P, Schultz E B, Schultz T P. Topological organic chemistry. 10. graph theory and topological indices of conformational isomers [J]. J Chem Inf Comput Sci, 1996, 36: 996.
- [5] Karelson M, Lobanov V S, Katritzky A R. Quantum-chemical descriptors in QSAR/QSPR studies [J]. Chem Rev, 1996, 96: 1027
- [6] 杨锋,罗明道,屈松生,等.点价 δ^V 的改造及其对 $A_n B_m$ 型过渡元素化合物标准生成焓的相关性研究[J].原子与分子物理学报,1998, 15(1): 110.
- [7] Stark J G, Wallace H G. The handbook of chemical data [M]. London: McGraw-Hill Book Company, 1975. 29.
- [8] 徐光宪,赵学庄. Slater 型原子轨函和电离能的近似计算法的改进[J].化学学报,1956, 22: 441.
- [9] 李良超,罗明道,屈松生,等.共价化合物的热力学性质与结构的关系 III—— $\text{SiH}_m \text{X}_n$ 的气相标准生成焓[J].西北大学学报,1993, 5: 437.
- [10] Pauline Ho, Michael E. A theoretical study of the heats of formation of SiH_n , SiCl_n and $\text{SiH}_n \text{Cl}_m$ compounds [J]. J Phys Chem, 1985, 89: 4647—4654.
- [11] Dean J A. Lange's handbook of chemistry. 13th edition [M]. London: McGraw-Hill Book Company, 1985. 9—67.
- [12] 刘靖疆.应用量子化学[M].北京:高等教育出版社,1994. 98.

STUDY ON STANDARD FORMATION ENTHALPIES OF $\text{SiH}_m \text{X}_n$ AND $\text{CH}_m \text{X}_n$ MOLECULES WITH CHARGE/RADIUS OF ATOMS

Xie Bing¹, Feng Lin², Yang Feng³, Luo Mingdao⁴, Qu Songsheng⁴

(1. Department of Chemistry, Guizhou Institute for Nationalities, Guiyang 550025, China; 2. Department of Chemistry, Chongqing Normal College, Chongqing 400715, China; 3. Institute of Environmental Science, Wuhan Institute of Science and Technology, Wuhan 430073, China; 4. Department of Chemistry, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: The atomic and molecular structure parameters P_i and P are defined as: $P_i = \frac{m_i}{4r_i} \left(1 + \frac{n_i^*}{n_i}\right) \left(1 + \frac{Z'_i + 2}{Z}\right)$, $P = \sum_{i=1}^n P_i$. The correlation relationships between P and the standard formation enthalpies of $\text{SiH}_m \text{X}_n$, $\text{CH}_m \text{X}_n$ ($\text{X}=\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) are studied showing the correlation coefficients 0.976 5, 0.975 2, respectively.

Key words: ratio of charge-radius; $\text{SiH}_m \text{X}_n$; $\text{CH}_m \text{X}_n$; standard formation enthalpies; correlativity.